

# 第89回 半導体・集積回路 技術シンポジウム

## 2025.8.28(木)・29(金) ハイブリッド開催

本シンポジウムは、わが国の半導体・集積回路技術分野における特色ある講演会として発足して以来、今回で第89回を迎えます。半導体集積回路の分野では、さらなる集積度と性能の向上が続いており、多様な技術の研究開発が進められています。第89回シンポジウムでは、三次元集積回路、メモリ、パワーデバイス、AIエレクトロニクスの各デバイス技術に加え、微細加工技術をはじめとする各種プロセス技術、半導体産業の動向、人材育成に関する1X件の招待講演を予定しています。

また、一般講演も募集しており、若手研究者や学生が研究成果を発表する場を設けます。半導体集積回路の研究開発や事業に従事する方々に、2日間に亘る活発な討論の場を提供します。

現地会場

東京理科大学森戸記念館  
第1フォーラム室

〒162-0825 新宿区神楽坂4-2-2

JR総武線・東京メトロ 飯田橋駅から徒歩7分

主催

電気化学会電子材料委員会

(URL:<https://semicon.electrochem.jp/>)

共催

ECS(米国電気化学会)日本支部、東京理科大学

協賛

応用物理学会、エレクトロニクス実装学会、  
精密工学会、電子情報通信学会、  
日本表面真空学会、日本化学会

### ■ 予定されている招待講演

◆第1日 ◆8月28日(木) 10:00~18:30	
10:00-10:10	開会の挨拶
10:10-10:50	半導体産業の利益率はどのように高いのか? — 固定費型企業の価格戦略 — (株)レゾナック 近藤誠一
10:50-11:30	半導体技術革新と環境負荷低減の共創に向けた東京エレクトロンの環境戦略「E-COMPASS」 東京エレクトロン(株) 梶公智
11:30-11:40	午前の発表についての全体質疑
11:40-13:00	昼食
13:00-13:40	FeRAM用Pb(Zr,Ti)O <sub>3</sub> キャパシタの薄膜化を実現する強誘電体/電極界面制御技術 RAMXEED(株) 中村亘
13:40-14:20	酸化ハフニウムが拓いた強誘電体メモリの新章:現状と展望 大阪公立大学 吉村武
14:20-15:00	Innovation and Challenges in the latest DRAM マイクロメモリジャパン(株) 藤田博文
15:00-15:10	午後前半の発表についての全体質疑
15:10-15:20	休憩
15:20-16:00	本格的実用化を迎えたSiCパワーデバイスの現状と課題 京都大学 木本 恒輔
16:00-16:40	高性能パワー半導体実現に向けたイオン注入・レーザーアニール技術 住友重機械イオンテクノロジー(株) 大野隆史
16:40-17:20	広島大学での半導体人材育成とイノベーション創出 広島大学 黒木 伸一郎
17:20-17:30	午後後半の発表についての全体質疑
17:30-17:40	休憩
17:40-18:30	一般講演セッション(ポスター)
18:30-19:30	情報交換会
◆第2日 ◆8月29日(金) 9:40~17:00	
9:40-10:20	Challenges in CoWoS <sup>®</sup> Technology Development for Further Evolution of AI/HPC TSMCジャパン 山口晋平(オンライン配信無)
10:20-11:00	高積層世代に向けた新規水平チャネル3次元フラッシュメモリ キオクシア(株) 小田 稔
11:00-11:40	異種材料基板の直接接合 産業技術総合研究所 高木秀樹
11:40-11:50	午前の発表についての全体質疑
11:50-13:00	昼食
13:00-13:40	定量的なプラズマプロセス制御に向けて 応用物理学会 辰巳哲也
13:40-14:20	次世代デバイスを支える成膜技術動向 東京エレクトロニクステクノロジーソリューションズ(株) 柴田哲弥
14:20-15:00	先端半導体用NTI(Negative-Tone Imaging)プロセスとその材料技術 富士フイルム(株) 橋本明
15:00-15:10	午後前半の発表についての全体質疑
15:10-15:20	休憩
15:20-16:00	AIで切り拓く先端欠陥検査技術の開発 (株)SCREENアドバンスシステムソリューションズ 岡山 敏之
16:00-16:40	大規模AIモデルの進展とAIアクセラレータの展望 (株)Preferred Networks 的矢知樹
16:40-16:50	午後後半の発表についての全体質疑
16:50-17:00	優秀発表賞贈呈、閉会の挨拶

講演募集： 一般講演を下記の要領で募集します。

- ・ 申し込みサイト <https://forms.gle/s3QK2TnXtwUnqfiA8> よりご応募ください。
- ・ 講演方法：現地会場でのショートプレゼンテーション+ポスター発表
- ・ 講演申込期限/アブストラクト提出期限：2025年8月8日(金)
- ・ 別途 A4版1ページ(図面を含む)のアブストラクトを提出してください(テンプレートに従ってください)。
- ・ アブストラクト送付先：電気化学会電子材料委員会事務局 [semicon@electrochem.jp](mailto:semicon@electrochem.jp)
- ・ テンプレートは、第89回半導体・集積回路技術シンポジウムのホームページ(<http://semicon.electrochem.jp/>)に掲載予定です。掲載前に必要とされる場合は、電気化学会電子材料委員会事務局にご連絡ください。電子メールでお送りします。
- ・ 学生発表者に1-2件のStudent Paper Award(優秀発表賞)を授与いたします。

#### 参加申込み方法

下記のURLから申込書式に従いお申し込みください。

<https://forms.gle/qTsVMojGxY7CrQAz7>

このサイトにアクセスできない場合には、以下のホームページのお問合せ画面よりお申し込みください。

<https://semicon.electrochem.jp/contact>

参加登録費(講演論文集(PDF)を含みます・**昼食は含まれませんので、各自でお取りください**・不課税・対面での参加とオンライン参加は同額です)

- ・ 事前申し込み：電気化学会及び共催・協賛学会の会員 20,000円 会員外 30,000円 学生 1,000円
  - ・ 当日参加：電気化学会及び共催・協賛学会の会員 30,000円 会員外 40,000円 学生 1,000円
- 領収書：9月1日に送付予定です。それ以前に必要とされる方は事務局にご連絡ください。

#### 振込先

みずほ銀行 豊洲支店(537) 普通口座3036686  
シヤ)デンキカガクカイデンシザイリヨウインカイ

#### 電気化学会電子材料委員会事務局

山梨大学近藤研究室 電気化学会電子材料委員会事務局  
電子メール：[semicon@electrochem.jp](mailto:semicon@electrochem.jp)

#### 開催要領

ハイブリッド開催とし、現地会場での対面の発表と聴講に加え、Zoomの使用を予定しています。

講演論文集のダウンロードIDとパスワードを開催前にメールにてお送り致します。第89回半導体・集積回路技術シンポジウムの講演論文集ホームページから取得していただく予定です。

#### 第89回半導体・集積回路技術シンポジウム論文委員会

電子材料委員会委員長：近藤英一(山梨大学)

プログラム委員会委員長：早瀬仁則(東京理科大学)

プログラム委員会委員：上野和良(横浜国立大学)、落水洋聡(ソシオネクスト)、百瀬健(熊本大学)、森義弘(SCREEN)、八重真治(兵庫県立大学)、柳至(日立製作所)、渡邊桂(KIOXIA)

電子材料委員会委員：伊藤理(ヌヴォトンテクノロジージャパン)、井上史大(横浜国立大学)、彦坂幸信(RAMXEED)、大森克己(東京応化工業)、北野尚武(Rapidus)、木野久志(九州大学)、小林清輝(電子科学)、近藤敏彰(愛知工科大学)、齊藤文靖(大阪公立大学)、清水智弘(関西大学)、筒井一生(東京科学大学)、藤方淳平(荏原製作所)、長谷川剛(早稲田大学)、前川和義(ルネサスエレクトロニクス)、松川和人(SUMCO)、水林亘(産業技術総合研究所)、森本保(東京エレクトロン)

電子材料委員会顧問：新宮原正三(関西大学)

本シンポジウムに関する案内はホームページにも掲載しています。( <http://semicon.electrochem.jp/> )